

光刻刻分析用曝光机UVES-2000

产品名称	光刻刻分析用曝光机UVES-2000
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

搭载了UV灯管光源、曝光光学镜头、曝光载台的光刻胶评价用的开放式专用曝光装置。

可以简单的测量光刻胶的敏感度。

曝光方式：step曝光

曝光位置：多25处

曝光区域：10mm × 10mm

对应波长：i线、g线、h线、Krf、broad band

滤波片：BDF（band pass filter）

用途：Eth测量、ABC参数计算、out gas测量

开放式专用曝光机

UVES-2000 (i线, g线, h线, Krf, broad band)

VUVES-4700 (krf, Arf)

WEX-200MCE (全面曝光, 接触式曝光